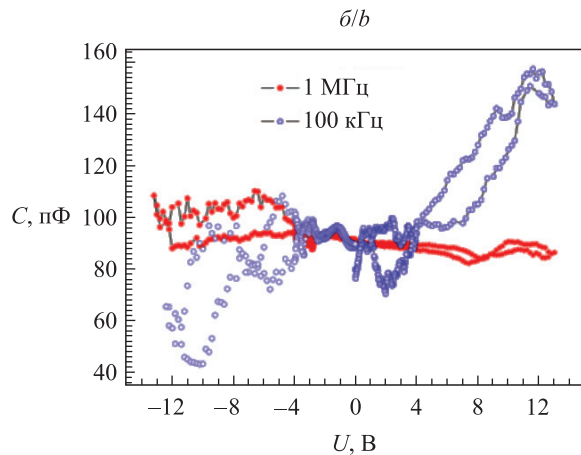
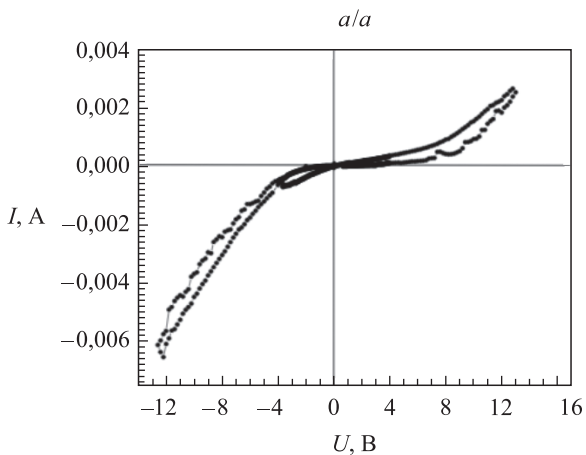




*Рис. 8.* Вольт-амперная (а) и вольт-фарадная (б) характеристики тонкой пленки оксида циркония, легированного оксидом иттрия, на кремнии

*Fig. 8.* Volt-ampere (a) and voltage-farad (b) characteristics of thin film of yttria doped zirconium oxide on silicon substrate